

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 1 区分
 【発行日】平成 23 年 10 月 27 日 (2011.10.27)

【公開番号】特開 2011-181529 (P2011-181529A)
 【公開日】平成 23 年 9 月 15 日 (2011.9.15)
 【年通号数】公開・登録公報 2011-037
 【出願番号】特願 2011-136431 (P2011-136431)
 【国際特許分類】

H 0 5 B 33/10 (2006.01)

H 0 1 L 51/50 (2006.01)

【F I】

H 0 5 B 33/10

H 0 5 B 33/14 A

H 0 5 B 33/22 C

【手続補正書】
 【提出日】平成 23 年 8 月 12 日 (2011.8.12)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】0 0 0 6
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【0 0 0 6】

本実施形態によれば、画素電極を形成する工程と、前記画素電極の表面を洗浄する第 1 洗浄工程と、前記第 1 洗浄工程によって除去し切れなかった異物もしくは前記第 1 洗浄工程の際に付着した異物が前記画素電極の上に存在している状態で、前記画素電極の上に第 1 酸化物層を形成する工程と、前記第 1 酸化物層の表面を洗浄し前記画素電極の上に存在した異物を除去する第 2 洗浄工程と、前記第 2 洗浄工程の後に、前記第 1 酸化物層の上及び前記第 1 酸化物層から露出していた前記画素電極の上に第 2 酸化物層を形成する工程と、前記第 2 酸化物層の上に有機層を形成する工程と、前記有機層の上に対向電極を形成する工程と、を備えたことを特徴とする有機 EL 装置の製造方法が提供される。

【手続補正 2】
 【補正対象書類名】特許請求の範囲
 【補正対象項目名】全文
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【特許請求の範囲】
 【請求項 1】

画素電極を形成する工程と、
 前記画素電極の表面を洗浄する第 1 洗浄工程と、
 前記第 1 洗浄工程によって除去し切れなかった異物もしくは前記第 1 洗浄工程の際に付着した異物が前記画素電極の上に存在している状態で、前記画素電極の上に第 1 酸化物層を形成する工程と、
 前記第 1 酸化物層の表面を洗浄し前記画素電極の上に存在した異物を除去する第 2 洗浄工程と、
 前記第 2 洗浄工程の後に、前記第 1 酸化物層の上及び前記第 1 酸化物層から露出していた前記画素電極の上に第 2 酸化物層を形成する工程と、
 前記第 2 酸化物層の上に有機層を形成する工程と、
 前記有機層の上に対向電極を形成する工程と、

を備えたことを特徴とする有機ＥＬ装置の製造方法。

【請求項２】

前記第１洗浄工程及び前記第２洗浄工程は、純水またはアルコール類を用いて行うことを特徴とする請求項１に記載の有機ＥＬ装置。

【請求項３】

前記第１酸化物層及び前記第２酸化物層は、無機化合物によって形成されたホール輸送性を有する材料によって形成したことを特徴とする請求項１または２に記載の有機ＥＬ装置。

【請求項４】

前記第１酸化物層及び前記第２酸化物層は、蒸着法によって形成することを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の有機ＥＬ装置。

【請求項５】

前記第１酸化物層は酸化モリブデンの薄膜であり、前記第２酸化物層は酸化モリブデンにマグネシウムをドーブした薄膜であることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の有機ＥＬ装置。